

# ستنتز ویسکرهای کاربید سیلیسیم نانو ساختار با مکانیزم بخار-مایع-جامد (VLS)

مهرتاب تیموری<sup>۱\*</sup>، احمد منشی<sup>۲</sup> و مسعود کثیری<sup>۳</sup>

۱- کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

۲- استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

۳- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

\*mteimoory@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۹۰/۰۵/۱۹، تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۱۲)

## چکیده

در این پژوهش از روش احیای کربوترمی و مکانیزم بخار-مایع-جامد (VLS) جهت تولید ویسکرهای کاربید سیلیسیم (SiC)، با استفاده از قیر قطران و سیلیس ضایعاتی، به عنوان مواد اولیه ارزان قیمت و پودر فروسیلیسیم به عنوان کاتالیزور استفاده شد. مخلوطهایی از مواد اولیه تهیه گردید و در دمای ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد، در کوره لوله‌ای با اتمسفر آرگون قرار داده شد. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD)، تشکیل فاز کاربید سیلیسیم را در محصولات تایید نمود. با بررسی مورفولوژی محصول به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، مشخص گردید که در حضور فروسیلیسیم به عنوان کاتالیزور، در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد، ویسکرهای کاربید سیلیسیم شکل گرفته‌اند و اندازه بلورک این الیاف، کمتر از ۵۰ نانومتر می‌باشد. هم‌چنین اثر فعال سازی مکانیکی بر روی اندازه بلورک SiC تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که در نمونه‌های آسیاب کاری شده، از شدت پیک‌های کاربید سیلیسیم کاسته شده و به پهنه‌ای آنها افزوده شده است و ۱۰-۵ نانومتر کاهش در اندازه بلورک‌ها مشاهده می‌شود که نشانگر جوانه زنی بیشتر یا رشد سریع‌تر ویسکرهای SiC می‌باشد.

## واژه‌های کلیدی:

ویسکرهای کاربید سیلیسیم، احیای کربوترمی، کربن، سیلیس، مکانیزم رشد بخار-مایع-جامد (VLS)

## ۱- مقدمه

آلوده، خرد شدن الیاف، غیریکنواختی ساختار کلی ماده در اثر به هم چسبیدن الیاف، واکنش‌های گستردۀ در فصل مشترک این تقویت کننده‌ها با زمینه و جهت دار شدن خواص، با توجه به جهت قرارگیری الیاف، از جمله دلایل توجه کمتر به این گروه از کامپوزیت‌ها بوده است. ویسکرهای رشته‌های کوتاه بدون مرز دانه هستند و با توجه به کاهش تقاضه شبکه‌ای در آن‌ها،

در سال‌های اخیر، ساخت کامپوزیت‌های حاوی الیاف کوتاه یا ویسکرها<sup>۱</sup>، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این موضوع به دلیل قیمت مناسب، دسترسی آسان و توسعه و تکامل فرایندهای تولید کامپوزیت با استفاده از این مواد است. به علاوه، مشکلات مربوط به تولید کامپوزیت‌های حاوی تقویت کننده‌های پیوسته نظری قیمت بالا، ساختار ناقص، سطوح

## ۲- مواد و روش تحقیق

در این پژوهش، از دو نوع قیر قطران<sup>۵</sup>، با درصد کربن و خواص فیزیکی متفاوت، استفاده شد. یک نوع قیر قطران جامد، به عنوان منع اصلی تامین کربن مورد نیاز واکنش‌ها و یک نوع قیر قطران مایع، به عنوان پیونددهنده (بایندر) مورد استفاده قرار گرفتند. از سیلیس ضایعاتی نیز به عنوان منع اصلی تامین سیلیسیم مورد نیاز واکنش‌ها و پودر فروسیلیسیم با دانه‌بندی کمتر از ۱۰۰ میکرون، به عنوان کاتالیزور، استفاده شد. وزن مخصوص ظاهری این پودر حدود  $۲/۸ \text{ g/cm}^3$  و نقطه ذوب آن حدود  $۱۳۱۵ - ۱۲۱۰^\circ\text{C}$  است. نوع و مقدار ناخالصی‌های موجود در سیلیس ضایعاتی نظیر  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  و  $\text{K}_2\text{O}$  می‌تواند در رشد ویسکرها مفید باشد [۱۳]. برخی مشخصات انواع قیر قطران به کار برده شده، در جدول (۱) آورده شده است.

جدول (۱): مشخصات انواع قیر قطران مورد استفاده در آزمایش‌ها

نقطه نرمی $^\circ\text{C}$	درصد کربن	نوع قیر قطران
۸۹-۱۰۲	۴۳	(Graphite Pitch) A
۲۵	۴۵	(Low Softening Point Pitch) B

در اولین مرحله از آزمایش‌ها، دو نمونه به صورت زیر تهیه گردید:

نمونه ۱: مخلوط قیر قطران نوع A و ماده تامین کننده سیلیسیم با نسبت وزنی ۱ (۱ گرم از هر ماده) به علاوه پودر فروسیلیسیم به مقدار ۴ درصد وزنی مخلوط، نمونه ۲: مخلوط ۱ گرم ماده تامین کننده سیلیسیم به علاوه پودر فروسیلیسیم به مقدار ۴ درصد وزنی آن (معادل  $۰/۰۴$  گرم)، سپس قیر قطران مایع به تدریج به هر دو نمونه اضافه شد تا به طور کامل با آن آغشته شوند و محلولی همگن و خمیری به دست آید. نمونه‌ها درون قایقک‌های مقاوم به دمای بالا ریخته شده و داخل کوره لوله‌ای با اتسفر آرگون قرار داده شدند. کوره با نرخ گرمادهی  $۶۰۰$  درجه سانتی‌گراد در ساعت تا دمای  $۱۳۰۰$  درجه سانتی‌گراد گرم شده و سپس به مدت ۲ ساعت در این دما نگه داشته شد.

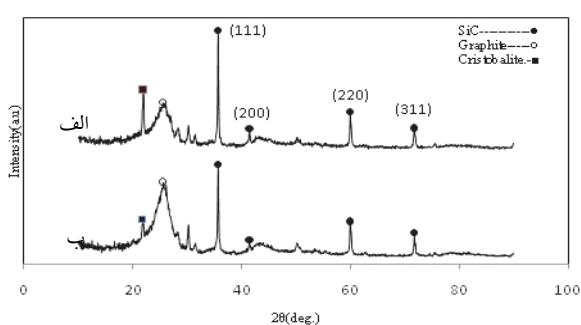
استحکام بسیار زیادی از خود نشان می‌دهند. ویسکرها اغلب دارای قطعی در حدود چند میکرون و طولی در حدود چند میلی‌متر می‌باشند [۱]. ویسکرهای کاربید سیلیسیم به علت دارا بودن خواص مکانیکی، گرمایی و شیمیایی عالی مانند ضریب انبساط حرارتی پایین، ضریب الاستیستیه و مقاومت حرارتی بالا، دانسیته کم و مقاومت بالا به اکسیداسیون به عنوان یک تقویت کننده مهم در کامپوزیت‌ها، اعم از زمینه فلزی، سرامیکی یا پلیمری، به کار می‌روند [۲]. هم‌چنین به دلیل عدم وجود نابجایی‌ها در حالت ایده‌آل، انتظار می‌رود که مدول یانگ و استحکام آن‌ها بسیار بالا باشد. این مواد به ویژه در جایی که مقاومت بالا به سایش نیاز است، کاربرد دارند [۳]. ویسکرها هم‌چنین چهره‌منگی شکست کامپوزیت را به دلیل توانایی بالا در جذب انرژی شکست، بهبود می‌بخشند [۴].

ویسکرهای کاربید سیلیسیم از روش‌های مختلفی تولید می‌شوند. از مهم‌ترین این روش‌ها، احیای کربوترمی (CTR)<sup>۶</sup> و رسوب شیمیایی بخار (CVD)<sup>۷</sup> با استفاده از مواد اولیه مختلف است [۲، ۵، ۶-۷]. ترکیب روش احیای کربوترمی با مکانیزم بخار-مایع-جامد (VLS)<sup>۸</sup>، پرکاربردترین روش سنتز ویسکرهای کاربید سیلیسیم است [۳ و ۸]. مکانیزم VLS مهم‌ترین مکانیزم تشکیل و رشد ویسکرهای کاربید سیلیسیم است. در این مکانیزم، از یک فاز گازی به عنوان منع ایجاد واکنش‌گرها و یک فاز مایع به عنوان کاتالیست واکنش استفاده می‌شود تا کربیتال‌های کاربید سیلیسیم به صورت جامد و به شکل ویسکر رسوب کنند. حضور ناخالصی‌ها به عنوان کاتالیزور، نقش مهمی در رشد ویسکرها دارد. رشد کربیتال به وسیله رسوب از مایع فوق اشباع در فصل مشترک مایع-جامد رخ می‌دهد. فاز مایع در حقیقت همان ناخالصی است که در دمای واکنش ذوب شده است. بنابراین، این مکانیزم در دماهای بالاتر از نقطه ذوب کاتالیزور عمل می‌کند [۳، ۶-۹، ۱۱]. بهترین کاتالیزورهای مورد استفاده در سنتز ویسکرهای کاربید سیلیسیم، فلزات واسطه و ترکیبات آهن می‌باشند [۱۲-۱۳، ۶-۱۰].

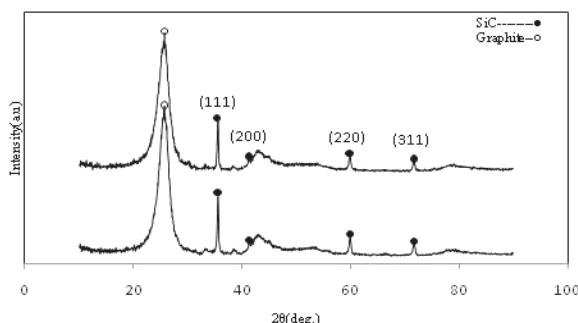
در این پژوهش، از روش شرر اصلاح شده، که به طور دقیق تری به محاسبه اندازه دانه کریستال می‌پردازد، استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از تک تک  $\theta$ ها و  $\beta$  (پهنهای پیک در نصف ماکریم ارتفاع) مخصوص به آن،  $\theta$ ، نمودار  $\ln\beta$  بر حسب  $\ln(1/\cos\theta)$  را رسم نموده و با به دست آوردن خطی با کمترین مربعات خطأ و شیب ثوری نزدیک به ۱ و استفاده از عرض از مبدأ خط به دست آمده، که برابر با  $\lambda = K\lambda/L$  می‌باشد و با داشتن  $K=0.89$  nm و  $L=0.154051$  nm یعنی اندازه بلورک محاسبه گردید.

### ۳- نتایج و بحث

الگوهای پراش پرتو ایکس، حضور کاربید سیلیسیم را در تمامی محصولات به خوبی تایید نمود. در تمامی نمونه‌ها، در کنار پیک کاربید سیلیسیم، پیک گرافیت نیز مشاهده می‌شود. تشکیل این فاز به دلیل قابلیت گرافیت شوندگی بسیار خوب قیر قطران در دماهای بالا است که زمینه‌ای از جنس گرافیت را ایجاد خواهد نمود. این الگوها در شکل‌های (۱) تا (۳) نشان داده شده‌اند.



شکل (۱): الگوی پراش پرتو ایکس: (الف) نمونه ۱، (ب) نمونه ۲، هر دو مورد سترن شده در دمای ۱۳۰۰°C.

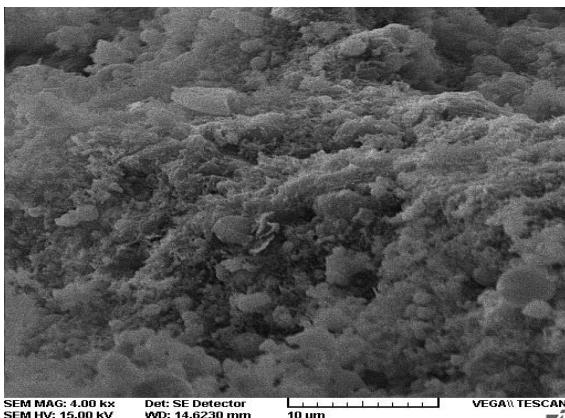


شکل (۲): الگوی پراش پرتو ایکس: (الف) نمونه ۱، (ب) نمونه ۲، هر دو مورد سترن شده در دمای ۱۴۰۰°C.

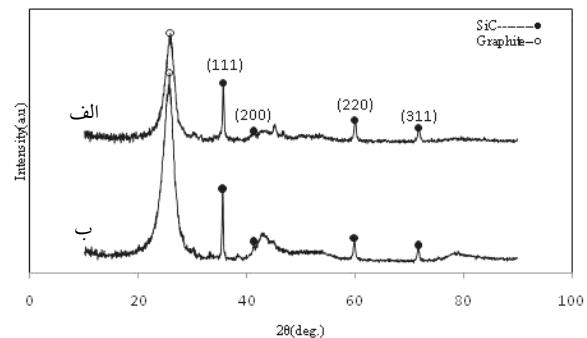
محصول این عملیات، پودری خاکستری رنگ بود که جهت آنالیز فازی آن، تحت پراش پرتو ایکس (XRD) قرار داده شد. هم‌چنین جهت بررسی مورفولوژی محصولات، از میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) استفاده گردید. در مرحله بعدی آزمایش‌ها، نمونه‌های ۱ و ۲ دوباره تهیه شده و مراحل فوق تکرار گردید و کوره تا دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد گرم شده و به مدت ۲ ساعت، در این دما نگه داشته شد. محصولات این مرحله نیز توسط XRD و SEM بررسی شدند. در مرحله پیمانی آزمایش‌ها، تاثیر فعال‌سازی مکانیکی بر کاربید سیلیسیم تولید شده، مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، مخلوط قیر قطران نوع A با ماده تامین کننده سیلیسیم با نسبت وزنی ۱/۱ گرم از هر ماده) تهیه شده و به مدت ۵ ساعت در یک آسیاب گلوله‌ای-سیارهای قرار داده شد. سپس پودر فروسیلیسیم به مقدار ۴ درصد وزنی مخلوط، به آن اضافه گردید. این نمونه نیز در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت در کوره قرار داده شد. محصول این آزمایش نیز توسط پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. در تمامی آزمایش‌های فوق، با استفاده از رابطه شرر اصلاح شده [۱۴] و روش کمترین مربعات خطأ، اندازه متوسط بلورک‌های کاربید سیلیسیم تولیدی محاسبه شد. با توجه به اینکه در روش شرر، اندازه کریستال‌ها به دست می‌آید و از طرفی، ویسکرهای کریستال‌های رشد کرده در جهت طولی هستند، می‌توان از این روش برای اندازه‌گیری قطر ویسکرهای SiC نیز استفاده نمود. شرر با به دست آوردن فرمول زیر که در آن  $L$  اندازه کریستال،  $K$  ثابت رابطه،  $\beta$  عرض در نصف ارتفاع پیک (قله فاز)،  $\lambda$  طول موج اشعه ایکس (نانومتر) و  $\theta$  زاویه پراش است، توانست از داده‌های به دست آمده از اشعه ایکس، اندازه کریستال‌های موجود در ذرات را محاسبه کند:

$$L=K\cdot\lambda/\beta\cos\theta \quad (1)$$

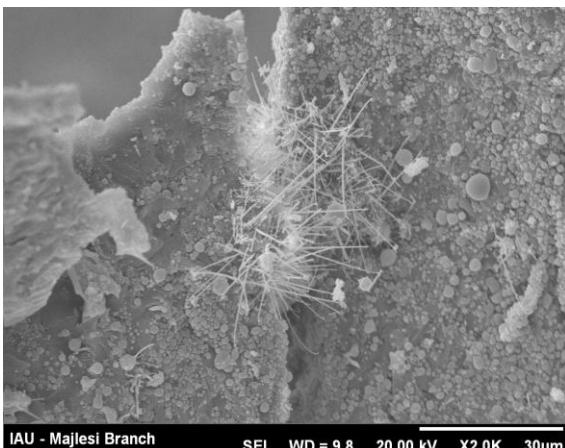
محاسبات نشان می‌دهند که با استفاده از رابطه شرر برای همه پیک‌های یک فاز، عددی ثابت برای اندازه کریستال به دست نمی‌آید. در روش یاد شده، از میانگین اندازه‌های به دست آمده از چند پیک استفاده می‌شود.



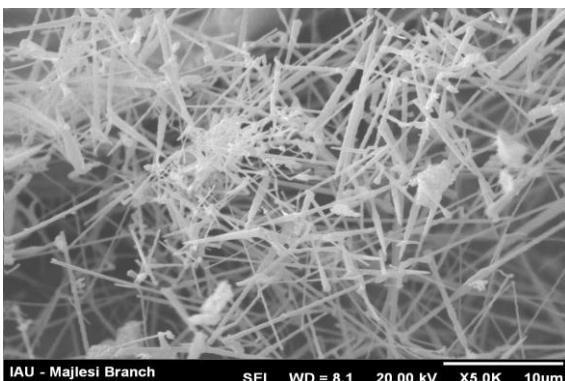
شکل (۴): تصویر تهیه شده SEM از نمونه ۱ سنتز شده در دمای  $1300^{\circ}\text{C}$ .



شکل (۳): الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ۱: (الف) ۵ ساعت آسیاب کاری شده، (ب) بدون آسیاب کاری، هر دو نمونه سنتز شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .



شکل (۵): تصویر تهیه شده توسط SEM از نمونه ۱ سنتز شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .



شکل (۶): تصویر تهیه شده توسط SEM از نمونه ۲ سنتز شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .

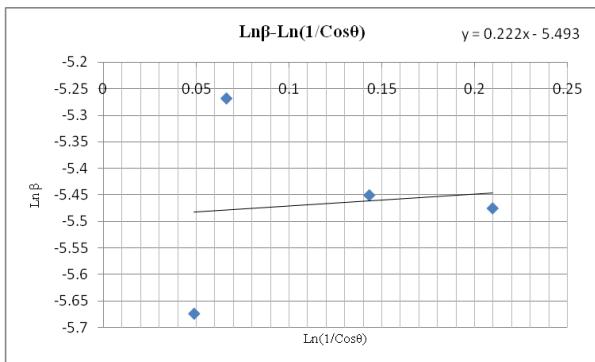
بر اساس تصاویر فوق، در محصول نمونه ۲، یعنی نمونه‌ای که فقط حاوی قیرقطران پیوند دهنده است، نسبت به نمونه دیگر که دو نوع قیرقطران در آن به کار رفته است، مقدار ویسکر بیشتری به وجود آمده است.

براساس تصاویر فوق، افزایش دمای واکنش از  $1300$  به  $1400$  درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت پیک‌های کاربید سیلیسیم شده است، یعنی بلورک‌ها ریزتر شده‌اند. احتمال می‌رود که در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$  نسبت به دمای  $1300^{\circ}\text{C}$  رشد الیاف SiC با مکانیزم VLS سریع‌تر باشد، زیرا محیط عمل برای انتشار ویسکرها آماده‌تر می‌شود. این موضوع باعث کاهش قطر الیاف SiC می‌شود و در XRD و روش شر اصلاح شده، مورد تایید قرار گرفت. الگوی پراش پرتو ایکس کاربید سیلیسیم حاصل از مواد اولیه آسیاب کاری شده نیز پیک‌های با شدت کمتر را ارائه می‌دهد که نشانگر کاهش اندازه بلورک‌ها می‌باشد و می‌تواند به سبب جوانه زنی بیشتر یا رشد سریع تر ویسکرها باشد.

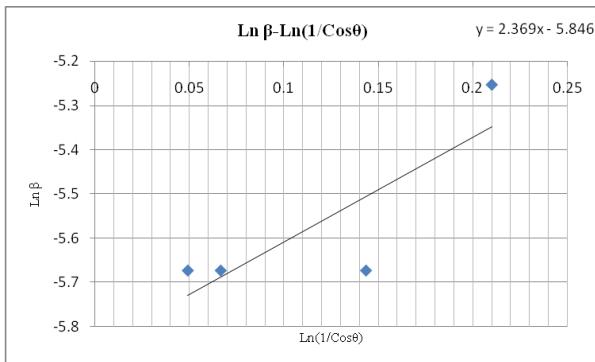
تصاویر SEM به دست آمده از نمونه‌های سنتز شده در دمای  $1300$  درجه سانتی گراد حاکی از این مساله است که ویسکرها کاربید سیلیسیم در آستانه شکل گیری قرار داشته اما نتوانسته اند شکل ویسکری خود را کامل کنند. شکل (۴) تصویر (۴) نمونه ۱ را نشان می‌دهد.

در بررسی مورفولوژی محصولات نمونه‌های سنتز شده در دمای  $1400$  درجه سانتی گراد به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، تشکیل الیاف کاربید سیلیسیم مورد تایید قرار گرفت. تصاویر SEM به دست آمده از این نمونه‌ها در شکل‌های (۵) و (۶) مشاهده می‌شوند.

در شکل های (۸ و ۹) نمودارهای رسم شده مشاهده می شوند.



شکل (۸): نمودار مربوط به نمونه ۱ سنتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .



شکل (۹): نمودار مربوط به نمونه ۲ سنتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .

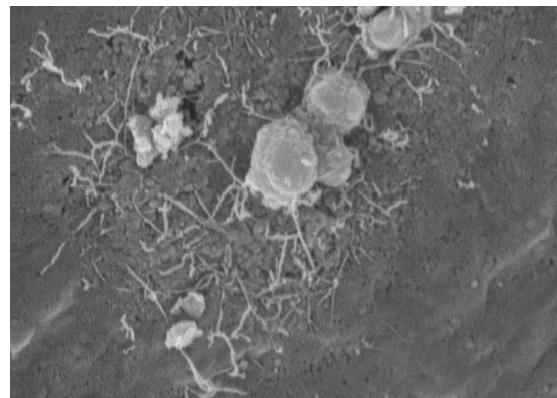
در رسم این نمودارها، از تعدادی از نقاط پرت صرف نظر شده است تا بتوان نزدیکترین شبیه به ۱ را داشت. اندازه بلورک های به دست آمده از نمونه های سنتر شده در دماهای  $1300$  و  $1400$  درجه سانتی گراد در جدول (۴) آورده شده است.

جدول (۴): اندازه بلورک های نمونه های ۱ و ۲ سنتر شده در دمای  $1300$  و  $1400^{\circ}\text{C}$ .

اندازه تقریبی بلورک سنتر شده در $1400^{\circ}\text{C}$	اندازه تقریبی بلورک سنتر شده در $1300^{\circ}\text{C}$	نمونه
۳۳ نانومتر	۴۳ نانومتر	۱ نمونه
۴۷ نانومتر	۵۵ نانومتر	۲ نمونه

اندازه بلورک های به دست آمده از نمونه ۱ آسیاب کاری شده، در مقایسه با نمونه بدون آسیاب کاری، در جدول (۵) آورده شده است.

شکل (۷) تصویر SEM مربوط به نمونه ۱ که قبل از قرار گرفتن در کوره، تحت آسیاب کاری بوده است را نشان می دهد.



شکل (۷): تصویر تهیه شده توسط SEM از نمونه ۱ آسیاب کاری شده و سپس سنتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .

همانطور که ملاحظه می شود، در مقایسه با الیاف تولید شده در نمونه ۱ بدون آسیاب کاری، این الیاف نازک تر می باشند. با استفاده از فرمول شر اصلاح شده و روش کمترین مربعات خط، اندازه متوسط بلورک کاربید سیلیسیم حاصل از هر یک از نمونه ها محاسبه گردید.

پیک های شاخص هر یک از نمونه ها در جداول (۲ و ۳) معرفی شده اند.

جدول (۲): پیک های شاخص نمونه ۱ سنتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .

زاویه (رادیان) $\beta$	(درجه) $\beta$	زاویه
۰/۰۰۳۴۳۴	۰/۱۹۶۸	۳۵/۵۶۷۸
۰/۰۰۵۱۵۱	۰/۲۹۵۲	۴۱/۲۹۶۱
۰/۰۰۴۲۹۲	۰/۲۴۶۰	۵۹/۹۰۱۰
۰/۰۰۴۱۸۸	۰/۲۴۰۰	۷۱/۶۶۲۵

جدول (۳): پیک های شاخص نمونه ۲ سنتر شده در دمای  $1400^{\circ}\text{C}$ .

زاویه (رادیان) $\beta$	(درجه) $\beta$	زاویه
۰/۰۰۳۴۳۴	۰/۱۹۶۸	۳۵/۶۰۱۲
۰/۰۰۳۴۳۴	۰/۱۹۶۸	۴۱/۳۲۷۹
۰/۰۰۳۴۳۴	۰/۱۹۶۸	۵۹/۸۹۳۰
۰/۰۰۵۲۳۵	۰/۳۰۰۰	۷۱/۶۸۸۴

## ۵- مراجع

- [1] N. Chawla, K. K .Chawla,"Metal Matrix Composites", Springer, ISBN 0387233067, 2006.
- [2] F. Qiangang, L. Hejun, Sh. Xiaohong, L. Kezhi, H. Zhibiao, W. Jian, "Microstructure and Growth Mechanism of SiC Whiskers on Carbon/Carbon Composites Prepared by CVD", Material Letters, Vol. 59, pp. 2593-2597, 2005.
- [3] M. Johnsson,"Synthesis of Boride, Carbide and Carbonitride Whiskers", Solid State Ionics, Vol. 172, pp. 365-368, 2004.
- [4] U. S. Patent No. 4,956,316, L. C. Sawyer,"Process for Dispersing Silicon Carbide Whiskers", 1990.
- [5] U. S. Patent No. 5,614,162, V. N. Gribkov, "Method Process for the Production of Long Fibrous Silicon Carbide Whiskers", 1997.
- [6] P. C. Silva, J. L. Figueiredo, "Production of SiC and  $\text{Si}_3\text{N}_4$  Whiskers in C+ $\text{SiO}_2$  Solid Mixtures", Materials Chemistry and Physics, Vol. 72, pp. 326-331, 2001.
- [7] X. K. Li, L. Liua, Y. X. Zhangb, Sh. D. Shenb, Sh. Geb, L. Ch. Ling, "Synthesis of Nanometre Silicon Carbide Whiskers from Binary Carbonaceous Silica Aerogels", Carbon, Vol. 39, pp. 159–165, 2001.
- [8] V. Martinez, M. F. Valencia, J. Cruz, J. M. Ejia, F. Chejne, "Production of  $\beta$  -SiC by Pyrolysis of Rice Husk in Gas Furnaces", Ceramic International, Vol. 32, pp. 891-897, 2006.
- [9] R. S. Wagner, W. C. Ellis, "Vapor-Liquid-Solid Mechanism of Crystal Growth", Applied Physics Letters, Vol. 4, pp. 89-91, 1964.
- [10] U. S. Patent No. 5,404,836, J. V. Milewski, "Method and Apparatus for Continous Controlled Production of Single Crystal Whiskers", 1995.
- [11] J. V. Milewski, F. D. Gac, J. J. Petrovic, S. R. Skaggs, "Growth of  $\beta$  -Silicon Carbide Chisksers by the VLS Process", Journal of Materials Science, Vol. 20, pp. 1160-1166, 1985.
- [12] V. G. Lutsenko,"Impurity Phases of Silicon Oxide in Commercial SiC Whiskers Produced by VLS Method", Material Chemistry and Physics, Vol. 115, pp. 664-669, 2009.
- [13] U. S. Patent No. 4,915,924, S. K. Nadkarni, M. K. Jain, "Method of Preparing Whiskers of Silicon Carbide and other Materials", 1990.

جدول (۵): اندازه بلورک های نمونه های ۱، ۲ و ۳ سنتز شده در دمای C

نمونه	اندازه تقریبی بلورک
نمونه ۱ بدون آسیاب کاری	۳۳ نانومتر
نمونه ۱ آسیاب کاری شده	۲۴ نانومتر

همانطور که ملاحظه می شود، نتایج به دست آمده از محاسبات فوق، کاهش اندازه بلورک کاربید سیلیسیم تولیدی را بر اثر افزایش دما و آسیاب کاری نشان می دهند. به نظر می رسد که عملیات آسیاب کاری باعث جوانه زنی جدید شده و رشد کمتری حاصل شده است.

## ۶- نتیجه گیری

- ۱- تشکیل فاز کاربید سیلیسیم با استفاده از قیرقطران و سیلیس ضایعاتی امکانپذیر است.
- ۲- بر اساس نتایج پراش پرتو ایکس، پس از ۲ ساعت قرار گرفتن ماده اولیه فوق در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد، کاربید سیلیسیم تولید می شود که میانگین اندازه بلورک آن ۵۰ نانومتر است، اما مورفولوژی الیاف دیده نمی شود.
- ۳- پس از ۲ ساعت قرار گرفتن ماده اولیه فوق در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد و در حضور کاتالیزور فروسیلیسیم، ویسکرهای کاربید سیلیسیم تولید می شوند.
- ۴- اندازه بلورک ویسکرهای تولید شده در دمای ۱۴۰۰ درجه ۳۰-۴۰ نانومتر می باشد و به طور متوسط کاربید سیلیسیم تولیدی می گردد. احتمال می رود که در دمای C نسبت به دمای C<sup>۱۴۰۰</sup> با مکانیزم SiC با مکانیزم VLS سریع تر باشد، زیرا محیط عمل برای انتشار سریع ویسکرها آماده تر می شود. این موضوع باعث کاهش قطر الیاف SiC شده و در XRD و روش شرر اصلاح شده، مورد تایید قرار گرفت.
- ۵- آسیاب کاری مواد اولیه، کاهش ۵-۱۰ نانومتر در اندازه بلورک کاربید سیلیسیم تولید شده را باعث می شود که می تواند به سبب جوانه زنی بیشتر یا رشد سریع تر ویسکرها باشد.

## ۶- پی نوشت

- 1-Whisker
- 2-Carbothermal Reduction
- 3-Chemical Vapor Deposition
- 4-Vapor- Liquid – Solid
- 5- Pitch

[ ۱۴ ] ا. منشی، س. سلطان عطار، " به کارگیری روشی نوین در اندازه گیری نانو ذرات با استفاده از رابطه شر و پراش پرتو ایکس،" فصلنامه علمی تخصصی مهندسی مواد مجلسی، سال دوم، شماره ششم، ص. ۹-۱۸، پاییز ۱۳۸۷.